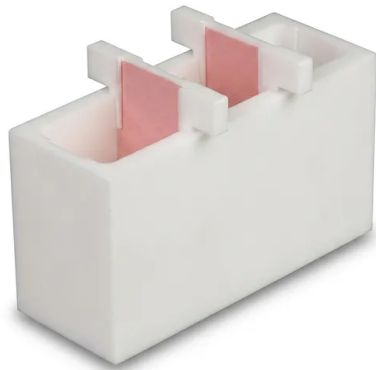


반도체 및 신에너지 연구용 실리콘 웨이퍼 가공 및 불산 내성을 갖춘 사각형 Ptfе 전기화학 셀

품목 번호: PL-CP151



소개

이 고순도 PTFE 사각형 전기화학 셀은 반도체 및 신에너지 분야의 실리콘 웨이퍼 가공을 위해 탁월한 불산 내성을 제공합니다. 완전히 사용자 정의가 가능한 치수와 엄격한 주문형 엔지니어링을 특징으로 하며, 까다로운 연구실 연구 및 산업 생산 요구 사항을 충족합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 웨이퍼 에칭	불산 기반 에칭액을 사용하여 실리콘 웨이퍼에서 물질 층을 제어하여 제거하는 데 사용됩니다.	재료 열화가 없고 공격적인 산의 정밀한 격리가 가능합니다.
광전지 연구	실리콘 기반 태양전지 층 및 코팅의 전기화학 효율을 테스트하고 최적화합니다.	대형 사각형 기반 전체에 균일한 전장 분포를 제공합니다.
리튬 이온 배터리 테스트	신에너지 저장 장치의 양극 및 음극 성능 분석을 위해 부식성 전해질을 수용합니다.	고급 배터리 화학 및 전해질 염에 대한 완전한 불활성을 제공합니다.
나노 제작 및 MEMS	고순도 화학 배스가 필요한 마이크로 전자 기계 시스템 제작을 위한 전문 용기입니다.	중요한 공정 단계 중 미량 금속 오염을 방지합니다.
전기 도금 공정	산성 또는 알칼리성 배스에서 반도체 기판이나 에너지 관련 구성 요소에 금속을 증착합니다.	도금 작업 중 극한 pH 수준과 높은 전류 밀도에 대한 저항성을 제공합니다.
부식 과학	화학 처리에서 발견되는 것과 같은 매우 공격적인 환경에서 재료의 내구성을 연구합니다.	장기 노출 시 유리 및 표준 폴리머보다 뛰어난 신뢰할 수 있는 격리 성능을 제공합니다.

사양	PL-CP151 상세 정보
제품 품목 번호	PL-CP151
주요 소재	고순도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
탱크 구성	사각형 / 직사각형 일체형 탱크
화학적 상호 작용성	불산, 황산, 황산, 강 알칼리, 유기 용매
기판 호환성	실리콘 웨이퍼 (2", 4", 6", 8", 12" 또는 주문형 크기에 맞춤화 가능)
작동 온도 범위	-200°C ~ +260°C
사용자 정의 옵션	고객 도면에 따른 맞춤형 치수, 벽 두께 및 포트 배치
<">제조 공정	정밀 CNC 가공 (엔드 투 엔드)
밀봉 구성 요소	선택 사항 PFA/PTFE 덮개, FKM/PTFE 개스킷 및 PFA 피팅
내부 마감	잔류물 축적을 최소화하는 초평활 저다공성 표면